

## Ti-6Al-4V中界面能对 $\alpha$ 相片层生长的影响三维相场模拟

杨梅<sup>1</sup>, 王刚<sup>2</sup>, 滕春禹<sup>1,3,4</sup>, 徐东生<sup>1</sup>, 张鉴<sup>5</sup>, 杨锐<sup>1</sup>, 王云志<sup>3</sup>

1. 中国科学院金属研究所, 沈阳 110016
2. 华南理工大学材料科学与工程学院, 广州 510640
3. The Ohio State University, Columbus OH 43210, USA
4. 东北大学理学院, 沈阳 110819
5. 中国科学院计算机网络信息中心, 北京 100190

## 3D PHASE FIELD SIMULATION OF EFFECT OF INTERFACIAL ENERGY ANISOTROPY ON SIDEPLATE GROWTH Ti-6Al-4V

YANG Mei<sup>1</sup>, WANG Gang<sup>2</sup>, TENG Chunyu<sup>1,3,4</sup>, XU Dongsheng<sup>1</sup>, ZHANG Jian<sup>5</sup>, YANG Rui<sup>1</sup>, WANG Yunzhi<sup>3</sup>

1. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016
2. School of Materials Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640
3. The Ohio State University, Columbus OH 43210, USA
4. College of Science, Northeastern University, Shenyang 110819
5. Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(39\)](#)

[相关文章\(15\)](#)

[点击分布统计](#)

[下载分布统计](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn